

薄膜沉积控制仪

Quark™ Rack Mounted Deposition Controller



全集成石英晶体薄膜沉积控制器

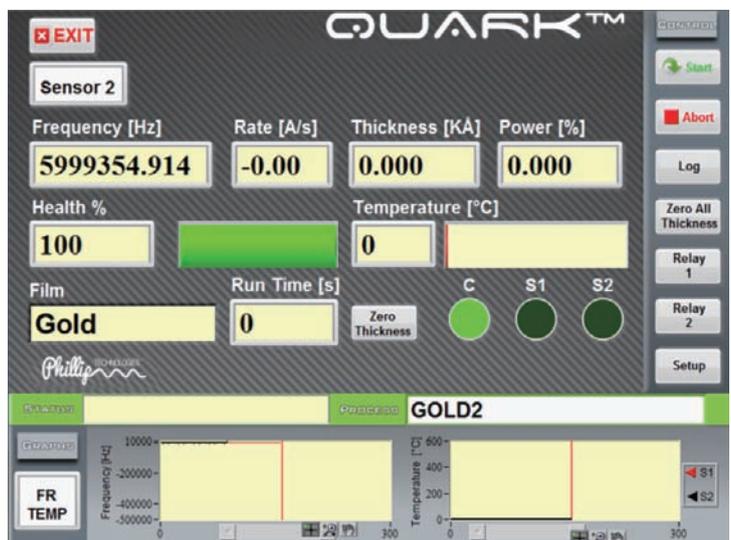
飞利浦质子科技通过前沿的频率-温度补偿技术带来了高分辨率的薄膜沉积控制系统 (Quark™ Rack Mounted Deposition Controller)，标准的19英寸机械安装架和多功能的触屏显示器。

整合了Nucleus Plus™技术，薄膜沉积控制仪在模块化的基础上建立了温度测量薄膜沉积控制系统。支持扩展4个输入输出和探头（2个标准仪器），实时的频率-温度曲线和500℃操作晶体。传统的检测和测量手段由于忽视了晶体温度的变化带来了极大的误差，通常误差为10%，在错误的环境下误差可以为100%。飞利浦通过监测实时的温度变化，从而对薄膜进行高精度极低误差控制。

薄膜沉积控制仪有非常高的稳定性和飞利浦产品惯有的精密度。6MHz（AT or RC™）的石英晶体前所未有的应用在了薄膜沉积领域。

功能齐全

可扩展的额外组件比如前面板的外部控制界面和后面板的探头、I/O卡。Millennium™控制系统包含一个过温控制继电器（以防探头冷却失灵）和输入/输出的可编辑性，给您全部的软件功能控制。



★ 彩屏可触摸的全软件功能控制面板

技术参数

标准参数	
探头	2个BNC 连接端（需要外部振荡器）
温度	2 type K TC
输入源	2 0-5 VDC 输入控制
继电器（不可编辑）	2个单刀单掷开关
输入端（可编辑）	8个独立的5V输入端
输出端（可编辑）	8个5A单刀单掷开关继电器
远程电源	手动电源控制-前面板FOB连接头
可扩展输入源卡	2个输入源、探头、继电器和type K TC
可扩展I/O卡	输入：8个独立的5V输入端 输出：8个5A单刀单掷
DAC 记录器	可根据用户的选择出发
参数	用户可以扩展 0-5V输出速率和厚度

测量参数	
频率分辨率	0.001Hz @6MHz(1s一个点)
采样率	0.5Hz to 100Hz
传感器晶体频率	5,6,7,8,9,10MHz

显示参数	
厚度（自动量程）	9999.9 to -999 kA
速率（自动量程）	9999.9 to -999 A
电源	00.00 to 99.99%
时间	0 to 99:59:59 HH:MM:SS
层数	0 to 999
屏幕	800x480 Full Color Touch Screen

连接参数	
标准方式	RS232 USB(Process Programming)
可选方式	以太网
创建程序	所有程序可以通过触摸屏和键盘编辑 CactusProg™可以在PC上创建菜单并可以通过U盘等闪存转移
性能	无限制的操作选项和编程

订货信息	
PTTC-RM	QUARK主机+1个探头+1个输入输出口
PTTC-RM2	QUARK主机+2个探头+1个输入输出口
PTTC-RM4	QUARK主机+2个探头+2个输入输出口
PTTC-RME1	QUARK主机+1个探头+2个输入输出口+以太网
PTTC-RME2	QUARK主机+2个探头+1个输入输出口+以太网
PTTC-RME4	QUARK主机+2个探头+2个输入输出口+以太网

